# CNT-Ag 복합패드가 Cu/Au 범프의 플립칩 접속저항에 미치는 영향

## 최정열 · 오태성<sup>†</sup>

홍익대학교 공과대학 신소재공학과

## Effect of CNT-Ag Composite Pad on the Contact Resistance of Flip-Chip Joints Processed with Cu/Au Bumps

Jung-Yeol Choi and Tae Sung Oh<sup>†</sup>

Department of Materials Science and Engineering, Hongik University, Seoul 121-791, Korea (Received August 31, 2015: Corrected September 15, 2015: Accepted September 18, 2015)

초 록: 이방성 전도접착제를 이용하여 Cu/Au 칩 범프를 Cu 기판 배선에 플립칩 실장한 접속부에 대해 CNT-Ag 복 합패드가 접속저항에 미치는 영향을 연구하였다. CNT-Ag 복합패드가 내재된 플립칩 접속부가 CNT-Ag 복합패드가 없 는 접속부에 비해 더 낮은 접속저항을 나타내었다. 각기 25 MPa, 50 MPa 및 100 MPa의 본딩압력에서 CNT-Ag 복합패 드가 내재된 접속부는 164 mΩ, 141 mΩ 및 132 mΩ의 평균 접속저항을 나타내었으며, CNT-Ag 복합패드를 형성하지 않 은 접속부는 200 mΩ, 150 mΩ 및 140 mΩ의 평균 접속저항을 나타내었다.

Abstract: We investigated the effect of CNT-Ag composite pad on the contact resistance of flip-chip joints, which were formed by flip-chip bonding of Cu/Au chip bumps to Cu substrate metallization using anisotropic conductive adhesive. Lower contact resistances were obtained for the flip-chip joints which contained the CNT-Ag composite pad than the joints without the CNT-Ag composite pad. While the flip-chip joints with the CNT-Ag composite pad exhibited average contact resistances of 164 m $\Omega$ , 141 m $\Omega$ , and 132 m $\Omega$  at bonding pressures of 25 MPa, 50 MPa, and 100 MPa, the flip-chip joints without the CNT-Ag composite pad had an average contact resistance of 200 m $\Omega$ , 150 m $\Omega$ , and 140 m $\Omega$  at each bonding pressure.

Keywords: stretchable packaging, flexible packaging, CNT-metal, flip chip, contact resistance

## 1.서 론

최근 스마트폰 기술이 ICT 산업의 지속적인 성장을 견 인할 추진력을 상실해 감에 따라 스마트폰을 대신하여 ICT 산업을 이끌 성장동력으로서 웨어러블 디바이스에 대한 연구개발이 활발히 진행되고 있다.<sup>1-12)</sup> 웨어러블 디 바이스 중에서 특히 심장박동 모니터링, 혈압 모니터링 및 체온 모니터링 디바이스와 같이 헬스케어 제품에 적 용하기 위해서는 유연성과 더불어 신축성을 갖춘 전자패 키징 기술이 요구되고 있다.

신축성 전자패키지에서 가장 어려운 기술이 신축성 회 로배선기술로서, 일반적으로 두가지 회로배선기술이 사 용되고 있다. 첫 번째 회로배선기술은 말굽 형태의 금속 도선을 사용한 기술로서 현재 대부분의 신축성 전자패키 지에서 가장 일반적으로 사용되고 있는 기술이나, 신축 성이 제한적이며 배선의 고밀도화가 어려운 단점이 있다. 두 번째 회로배선기술은 카본나노튜브(CNT), 나노금속 과 고분자로 구성된 신축성 복합배선기술로서 복합배선 의 전도도가 말굽형태의 금속배선에 비해 낮은 단점이 있 으나, 신축성이 우수한 장점이 있다.<sup>1,2,4,18)</sup> CNT-금속-고 분자 구조의 복합배선을 사용하여 신축성 전자패키지를 구성하기 위해서는 Si 반도체 칩을 기판의 복합배선과 연 결하는 플립칩 공정기술의 개발이 요구된다.<sup>1,13)</sup>

전자패키징에서 사용되는 플립칩 공정기술로는 크게 솔더 리플로우를 이용하는 플립칩 공정과 이방성 전도필 름(anisotropic conductive film: ACF), 이방성 전도접착제 (anisotropic conductive adhesive: ACA) 또는 비전도성 접 착제를 사용하는 플립칩 공정으로 나눌 수 있다.<sup>[8-21]</sup> 이

<sup>†</sup>Corresponding author

E-mail: ohts@hongik.ac.kr

© 2015, The Korean Microelectronics and Packaging Society

This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License(http://creativecommons.org/ licenses/by-nc/3.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

중 솔더 리플로우 플립칩 공정은 CNT와 고분자에 대한 솔더의 젖음성이 없기 때문에 CNT-금속-고분자 복합배 선에 대한 플립칩 공정에는 적용하기 어렵다.<sup>18,19)</sup> 반면에 ACF 또는 ACA를 이용한 플립칩 공정에서는 이들 접착 제에 함유되어 있는 전도성 입자들과 복합배선의 CNT 및 금속분말 사이의 접촉에 의해 전기전도가 이루어지게 되므로,<sup>21-23)</sup> CNT-금속-고분자 복합배선에 대한 플립칩 공 정에 적용이 가능하다.

본 연구에서는 신축성 전자패키지를 개발하기 위한 기 초연구로서, ACA를 사용하여 형성한 플립칩 접속부의 접속저항에 미치는 CNT-Ag 복합패드의 영향을 규명하 고자 하였다. 본 연구에서는 기판에 CNT-Ag-고분자 복합 배선을 형성하고 이에 Cu/Au 칩 범프를 ACA로 플립칩 본딩하는 대신에, 실험의 수월성을 위해 Cu/Au 칩 범프 가 플립칩 본딩되는 부위에만 CNT-Ag 복합패드를 형성 하여 이를 기판의 Cu 배선에 ACA로 플립칩 본딩하였다. CNT-Ag-고분자 복합패드 대신에 CNT-Ag 복합패드를 사 용한 이유는 고분자를 함유한 복합패드 페이스트의 제조 공정이 어렵기 때문에 이에 대한 선행연구로서 고분자를 함유하고 있지 않은 CNT-Ag 복합패드를 사용하여 기초 자료를 얻고자 하였다. 향후 CNT-Ag-고분자 복합 페이스 트가 개발되면 CNT-Ag-고분자 복합 페이스 트가 개발되면 CNT-Ag-고분자 복합패드에서의 접속저항 을 본 연구의 결과와 비교하고자 한다.

#### 2. 실험 방법

신축성 전자패키지에서는 기판 재료로서 신축성이 뛰 어난 탄성 고분자인 polydimethylsiloxane (PDMS)를 주로 사용하고 있으나,<sup>2,13,14)</sup> 본 연구는 신축성 PDMS 기판에 플립칩 공정을 적용하기 위한 기초연구로서 플립칩 공정 용 칩과 기판을 모두 Si 웨이퍼를 사용하여 형성하였다. 또한 CNT-Ag 복합패드를 기판 배선에 형성하고 이에 Cu/ Au 칩 범프를 플립칩 본딩하는 대신에, 용이한 실험을 위 해 Cu/Au 칩 범프에 CNT-Ag 복합패드를 형성한 후 이를 기판 배선의 패드에 플립칩 본딩하여 Fig. 1의 모식도와 같은 시편을 제작하였다.

Cu/Au 범프 위에 CNT-Ag 복합패드가 형성되어 있는 칩 시편은 Si 웨이퍼에 daisy-chain 구조로 제작하였다. Si 웨이퍼에 접착층으로서 Ti를 0.1 μm 두께로 스퍼터링한 후, 그 위에 접속저항 측정을 위한 배선층과 Au 전기도 금의 씨앗층 역할을 할 Cu를 2 μm 두께로 스퍼터링 하 였다. 이와 같이 Ti/Cu를 스퍼터링한 Si 웨이퍼에 포토레 지스트 패턴을 형성한 후, Cu 도금액에 장입하고 20 mA/ cm<sup>2</sup>의 전류밀도를 인가하여 10 μm 두께의 Cu를 전기도 금하였다. 이와 같은 시편에서 포토레지스트 패턴을 제 거하지 않고 증류수로 세척한 후, Au 도금용액에 다시 장 입하여 2 mA/cm<sup>2</sup>의 전류밀도로 Au를 전기도금 하였다. Cu 전기도금액의 조성은 CuSO<sub>4</sub>·5H<sub>2</sub>O 62.42 g/L, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 98 g/L, CuCl<sub>2</sub> 0.17 g/L, PEG600 300 ppm, MPSA 10 ppm



Fig. 1. Schematic illustration for the flip-chip bonded specimen with the CNT-Ag composite pad formed at the flip-chip joint.

이었으며, Au 도금액의 조성은 KAu(CN)<sub>2</sub> 3 g/L, make-up 용액 500 ml/L로 구성되었다. 이와 같이 15 μm 높이의 Cu/Au 범프가 형성된 Si 칩에서 회로배선을 제외한 부위 의 Ti/Cu 박막을 습식에칭으로 제거하였다. Cu/Au 범프 들은 직경 150 μm의 원통형 형상으로 범프들 사이의 피 치는 300 이며, 한 칩에 88개의 범프를 형성하였다.

Cu/Au 칩 범프 위의 CNT-Ag 복합패드는 (주)바이오니 아에서 제공한 CNT에 Ag 나노입자가 결합된 CNT-Ag 나 노복합 페이스트(Fig. 2 참조)를 사용하여 형성하였다. 80 µm 두께의 스테인레스 강으로 제작한 메탈 마스크를 칩 시편의 Cu/Au 범프 위에 배열한 후 CNT-Ag 나노복합 페 이스트를 스크린 프린팅하고 120℃에서 20분간 유지시 켜 CNT-Ag 나노복합 페이스트를 경화시켜 Cu/Au 칩 범 프 위에 CNT-Ag 복합패드를 형성하였다.

Cu 배선이 형성되어 있는 플립칩 본딩용 기판 시편을 제작하기 위해 Si 웨이퍼에 칩 시편의 제작시와 동일한 방법으로 0.1 μm 두께의 Ti와 2 μm 두께의 Cu 박막을 순 차적으로 스퍼터링하고, 그 위에 AZ4620 포토레지스트 를 사용하여 daisy chain 형상의 패턴을 형성하였다. 이후 노출된 Ti/Cu를 10% HNO<sub>3</sub>와 10% HF를 순차적으로 이 용하여 습식에칭하고 포토레지스트 패턴을 제거하여 Cu 배선이 형성된 기판 시편을 제작하였다.

약 4 μm 직경의 Ni-코팅 폴리머 전도입자가 함유된 Hujikura Kasei의 ACA를 CNT-Ag 복합패드를 도포한 Cu/ Au 칩 범프에 도포하고 기판의 Cu 패드에 플립칩 배열한 후, 본딩압력을 25 MPa에서 100 MPa 범위에서 변화시키



Fig. 2. Transmission electron microscopy of the CNT-Ag nanocomposite used to form CNT-Ag composite pads (Courtesy of Bioneer Inc.).

면서 18°C/sec의 승온속도로 180°C까지 승온하여 30초간 유지하여 플립칩 본딩하였다. CNT-Ag 복합패드가 플립 칩 접속부의 접속저항에 미치는 영향을 분석하기 위해 Cu/Au 칩 범프 위에 CNT-Ag 복합패드를 형성하지 않은 칩을 기판의 Cu 패드에 플립칩 실장한 시편도 함께 제작 하여 CNT-Ag 복합패드의 유무에 따른 플립칩 접속부의 접속저항을 비교 분석하였다.

## 3. 결과 및 고찰

Fig. 3에 Si 칩에 전기도금으로 형성한 Cu/Au 범프의 광 학현미경 사진과 주사전자현미경 사진을 나타내었다. 접 착제 플립칩 공정에서는 금속 범프의 평탄도가 플립칩 접 속저항에 영향을 미치는데, 본 실험에서는 전기도금으로 Fig. 3과 같이 평탄도가 비교적 우수한 Cu/Au 범프를 형 성하였다.

Fig. 4에 CNT-Ag 복합패드가 형성된 Cu/Au 범프를 갖 는 칩을 사용하여 본딩압력을 25 MPa에서 100 MPa 범 위에서 변화시키며 플립칩 본딩한 시편에서 관찰한 플립 칩 접속부의 단면 주사전자현미경 사진을 나타내었다. 이 와 더불어 Fig. 5에는 CNT-Ag 복합패드가 없는 Cu/Au 범 프를 갖는 칩을 플립칩 실장한 시편에서 관찰한 플립칩 접속부의 단면주사전자현미경 사진을 나타내었다. CNT-Ag 복합패드의 유무에 상관없이 Cu/Au 칩 범프와 기판 Cu 패드 사이에 ACA의 Ni-코팅된 전도 입자들이 포획되 어 플립칩 접속부를 형성하고 있는 것이 관찰되었다. CNT-Ag 복합패드가 존재하는 접속부와 존재하지 않는 접속부에서 모두 Ni-코팅된 전도 입자들이 변형되어 칩 과 기판 사이의 전기 통로를 형성하고 있는 것을 관찰할 수 있었다. 플립칩 접속부에 CNT-Ag 복합패드가 있는 경 우에는 CNT-Ag 복합패드가 없는 접속부와 비교하여 동 일한 본딩압력에서 Ni-코팅된 전도 입자들의 변형되는 정



Fig. 3. (a) An optical micrograph and (b) a scanning electron micrograph of Cu/Au chip bumps.



Fig. 4. Cross-sectional scanning electron micrographs of the flipchip joints processed by flip-chip bonding the Cu/Au chip bumps with CNT-Ag composite pads to Cu substrate pads at a bonding pressure of (a) 25 MPa, (b) 50 MPa, and (c) 100 MPa.



Fig. 5. Cross-sectional scanning electron micrographs of the flipchip joints processed by flip-chip bonding the Cu/Au chip bumps without CNT-Ag composite pads to Cu substrate pads at a bonding pressure of (a) 25 MPa, (b) 50 MPa, and (c) 100 MPa.

도가 약간이나마 작았는데, 이는 플립칩 접속부에 존재 하는 CNT-Ag 복합패드가 플립칩 본딩압력에 대한 완충 재 역할을 어느 정도 한 것으로 판단된다.

CNT-Ag 복합패드가 형성된 Cu/Au 칩 범프를 사용하 여 플립칩 본딩한 시편과 CNT-Ag 복합패드가 없는 Cu/ Au 칩 범프를 사용하여 플립칩 본딩한 시편에 대해 본딩 압력에 따른 플립칩 접속부의 평균 접속저항을 측정하였



Fig. 6. Average contact resistance of the flip-chip joints processed by flip-chip bonding the Cu/Au chip bumps with and without CNT-Ag composite pads vs. bonding pressure.

으며, 이들을 Fig. 6에 나타내었다. CNT-Ag 복합패드가 형성된 Cu/Au 칩 범프를 사용하여 25 MPa의 본딩압력에 서 플립칩 본딩한 시편은 164 mΩ의 평균 접속저항을 나 타내었으며, 50 MPa의 본딩압력 조건에서는 141 mΩ 100 MPa의 본딩압력 조건에서는 132 mΩ의 평균 접속저항을 나타내었다. 반면에 CNT-Ag 복합패드를 형성하지 않은 Cu/Au 칩 범프를 사용하여 25 MPa의 본딩압력에서 플립 칩 본딩한 시편은 200 mΩ의 평균 접속저항을 나타내었 으며, 50 MPa의 본딩압력 조건에서는 150 mΩ, 100 MPa 의 본딩압력 조건에서는 140 mΩ의 평균 접속저항을 나 타내었다. CNT-Ag 복합패드의 유무에 무관하게 본딩압 력이 25 MPa에서 100 MPa로 증가함에 따라 플립칩 접 속저항이 감소하였다. ACF를 사용한 플립칩 공정에서 플 립칩 접속부의 접속저항은 본딩압력에 의존하는데, 본딩 압력을 증가시킴에 따라 접속저항이 증가하다 최소값에 도달한 후 본딩압력을 더 감소시키면 접속저항이 증가한 다고 보고되고 있다.22,23)

Fig. 6에서 플립칩 접속부에 CNT-Ag 복합패드가 내재 된 시편이 CNT-Ag 복합패드가 없는 시편에 비해 더 낮 은 플립칩 접속저항을 나타내었다. 이는 CNT-Ag 복합패 드가 없는 플립칩 시편에서는 플립칩 접속부의 통전이 접 속부에 포획된 ACF 전도성 입자들에 의해서만 이루어지 는 반면에, CNT-Ag 복합패드를 형성한 플립칩 시편에서 는 ACF 전도성 입자들에 의한 주된 통전과 더불어 플립 칩 접속부를 채우고 있는 CNT-Ag 복합패드의 전기비저 항이 수 kΩ·m 정도로 상대적으로 높지만 이를 통해서도 원활하지는 않으나 보조적인 통전이 이루어지기 때문인 것으로 판단된다. Fig. 5에 나타낸 CNT-Ag 복합패드가 없 는 플립칩 접속부에서는 그림 4와 같이 CNT-Ag가 Cu/Au 칩 범프와 Cu 기판패드 사이에 채워져 있는 것을 관찰할 수 있다. Fig. 6에서 본딩압력이 높아질수록 CNT-Ag 복합패 드의 유무가 플립칩 접속저항에 미치는 영향이 작아지는 것으로 관찰되었다. 이는 본딩압력에 따라 ACF 전도입 자의 변형정도가 변하여 전도입자를 통한 전기전도의 정 도가 본딩압력에 민감한 반면에, CNT-Ag 복합패드의 비 저항은 kΩm 단위로 상대적으로 높기 때문에 본딩압력 에 따른 변화가 크지 않기 때문으로 판단된다.

Fig. 6에 나타낸 CNT-Ag 복합패드를 내재한 플립칩 접 속부의 평균 접속저항을 참고문헌에 보고된 값들과 비교 해 보고자 하였다. 칩과 기판의 Au metallization에 plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD)을 사용하여 CNT 번들을 수직으로 성장시켜 CNT 범프를 형성한 후, 칩 CNT 범프를 기판 CNT 범프에 플립칩 접속하였다는 보고가 있으나,<sup>24,25)</sup> 이와 같은 CNT-CNT 플립칩 접속부 는 본 연구에서 사용한 Cu/Au/CNT-Ag/Cu 플립칩 접속부 와 완전히 다른 구조로 접속저항 특성의 직접적인 비교 가 어렵다. CNT-금속 복합재료를 플립칩 접속용 범프 또 는 패드로 사용하고자 하는 연구가 보고되었으나,<sup>26)</sup> 전기 도금으로 CNT-Cu 복합도금을 형성하는 실험이 진행되었 을 뿐 이를 이용한 플립칩 본딩에 대한 연구가 이루어지 지 않아 본 연구의 결과와 비교할 수 없었다.

본 연구의 결과와 직접적인 비교가 가능한 연구로는 ACA를 사용하여 Cu/Sn 칩 범프를 플립칩 본딩한 접속부 에서 CNT-Ag 복합패드가 접속저항에 미치는 영향에 대 한 보고가 있는데,<sup>1)</sup> 본 연구의 결과와는 달리 CNT-Ag 복 합패드가 형성된 Cu/Sn 칩 범프의 접속부가 CNT-Ag 복 합패드가 없는 접속부에 비해 더 높은 접속저항을 나타 내는 것으로 보고되었다.<sup>1)</sup> CNT-Ag 복합패드가 형성된 Cu/Sn 범프 접속부는 25 MPa과 50 MPa의 본딩압력에서 는 접속저항이 너무 커서 측정이 안 되며 100 MPa의 본 딩압력 조건에서는 213 mΩ인 반면, CNT-Ag 복합패드가 없는 Cu/Sn 범프 접속부는 25 MPa, 50 MPa 및 100 MPa 의 본딩압력 조건에서 각기 1370 mΩ, 372 mΩ 및 112 mΩ 의 접속저항을 갖는다고 보고되었다.<sup>1)</sup> 본 연구에서 측정 한 Cu/Au 범프 접속부보다 기존 보고에 의한 Cu/Sn 범프 접속부가 CNT-Ag 복합패드의 유무에 무관하게 더 큰 접 속저항을 나타내었다.<sup>1)</sup> 이와 같이 두 연구에서의 상이한 결과는 기존 연구에서 사용한 Cu/Sn 칩 범프의 Sn과 본 연구에서 사용한 Cu/Au 칩 범프의 Au의 경도 차이에 기 인하는 것으로 판단된다. 1 N의 하중을 인가하면서 측정 한 Au 전기도금 박막과 Sn 전기도금 박막의 비커스 경도 (H<sub>v</sub>)는 각기 34 ± 2와 5 ± 0.2로 Au 전기도금 박막의 경도 가 Sn 전기도금 박막보다 7배 정도 높은 값을 나타내었 다. 기존 연구와 본 연구에서는 모두 플립칩 공정에 4 µm 입경의 Ni-코팅된 전도입자가 함유된 동일한 ACA를 사 용하였다. 기존 연구의 Cu/Sn 칩 범프를 사용한 플립칩 접속부에서는 Sn 표면층의 경도가 낮아 ACA 전도입자 의 변형 및 이에 의한 전도가 이루어지지 않는 반면에,<sup>1)</sup> 본 연구에서는 Cu/Au 칩 범프의 Au 표면층의 경도가 높

아 Fig. 4과 같이 ACA 전도입자들의 충분한 변형 및 이 에 의한 전기전도가 이루어져 Cu/Sn 범프 접속부보다 더 낮은 접속저항을 나타내는 것으로 판단된다.

#### 4. 결 론

신축성 전자패키지를 개발하기 위한 기초연구로서, ACA를 이용하여 Cu/Au 칩 범프를 기판의 Cu 배선에 플 립칩 실장한 접속부에 대해 CNT-Ag 복합패드가 접속저 항에 미치는 영향을 연구하였다. CNT-Ag 복합패드의 유 무에 상관없이 Cu/Au 칩 범프와 기판 Cu 패드 사이에 ACA의 Ni-코팅된 전도 입자들이 포획되어 플립칩 접속 부를 형성하고 있었다. CNT-Ag 복합패드가 내재된 플립 칩 접속부가 CNT-Ag 복합패드가 없는 접속부에 비해 더 낮은 접속저항을 나타내었다. 각기 25 MPa, 50 MPa 및 100 MPa의 본딩압력에서 CNT-Ag 복합패드가 형성된 접 속부는 164 mΩ 141 mΩ 및 132 mΩ의 평균 접속저항을 나타내었으며, CNT-Ag 복합패드를 형성하지 않은 접속 부는 200 mΩ, 150 mΩ 및 140 mΩ의 평균 접속저항을 나 타내었다. 이와 같은 결과로부터 ACA를 사용하여 CNT-Ag 복합배선에 플립칩 실장시 Cu 배선에 대한 기존의 금 속 범프와 금속 패드간의 플립칩 본딩과 비교하여 접속 저항이 증가하는 문제점은 발생하지 않을 것으로 판단할 수 있다.

### 감사의 글

본 연구는 본 연구는 미래창조과학부 및 정보통신기술 진흥센터의 정보통신 · 방송 연구개발사업의 일환으로 수행하였음 [14-000-11-001, 인간친화형 디바이스(스킨패 치, 멀티모달 서피스) 및 디바이스 소셜 프레임워크 기술 개발].

#### References

- J. Y. Choi and T. S. Oh, "Flip Chip Process on CNT-Ag Composite Pads for Stretchable Electronic Packaging", J. Microelectron. Packag. Soc., 20(4), 17 (2013).
- M. Gonzalez, B. Vandervelde, W. Chistianens, Y.-Y. Hsu, F. Iker, F. Bossuyt, J. Vanfleteren, O. van der Sluis, and P. H. M. Timmermans, "Thermo-Mechanical Analysis of Flexible and Stretchable Systems", 11<sup>th</sup> International Conference of Thermal, Mechanical and Multiphysics Simulation and Experiments in Micro-Electronics and Micro-Systems (Euro-SimE), Berlin, 1, Institute of Electrical and Electronics Engineers (2010).
- J. H. Ahn, H. Lee, and S. H. Choa, "Technology of Flexible Semiconductor/Memory Device", J. Microelectron. Packag. Soc., 20(2), 1 (2013).
- 4. J. Xiao, A. Carlson, Z. J. Liu, Y. Huang, H. Jiang, and J. A. Rogers, "Stretchable and Compressible Thin Films of Stiff Materials on Compliant Wavy Substrates", App. Phys. Lett.,

93, 013109 (2008),

- T. Löher, D. Manessis, R. Heinrich, B. Schmied, J. Vanfleteren, J. DeBaets, A. Ostmann, and H. Reichl, "Stretchable Electronic Systems", Proc. 59<sup>th</sup> Electronic Components and Technology Conference (ECTC), San Diego, 893, IEEE Components, Packaging and Manufacturing Technology Society (CPMT) (2009).
- T. Sekitani, Y. Noguchi, K. Hata, T. Fukushima, T. Aida, and T. Someya, "A Rubberlike Stretchable Active Matrix Using Elastic Conductors", Science, 321, 1468 (2008).
- D. H. Kim, J. H. Ahn, W. M. Choi, H. S. Kim, T. H. Kim, J. Song, Y. Y. Huang, Z. Liu, C. Lu, and J. A. Rogers, "Stretchable and Foldable Silicon Integrated Circuits", Science, 320, 507 (2008).
- M. Gonzalez, F. Axisa, M. V. Bulcke, D. Brosteaux, B. Vandevelde, and J. Vanfleteren, "Design of metal interconnects for stretchable electronic circuits", Microelectron. Reliab., 48, 825 (2008).
- T. Sekitani, H. Nakajima, H. Maeda, T. Fukushima, T. Aida, K. Hata, and T. Someya, "Stretchable Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode Display Using Printable Elastic Conductors", Nature Mater., 8, 494 (2009).
- J. H. Ahn and J. H. Je, "Stretchable Electronics: Materials, Architectures and Integrations", J. Phys. D: Appl. Phys., 45, 102001 (2012).
- D. H. Kim and J. A. Rogers, "Stretchable Electronics: Materials Strategies and Devices", Adv. Mater., 20, 4887 (2008).
- J. Y. Choi, D. H. Park, and T. S. Oh, "Chip Interconnection Process for Smart Fabrics Using Flip-Chip Bonding of SnBi Solder", J. Microelectron. Packag. Soc., 19(3), 71 (2012).
- T. Löher, D. Manessis, R. Heinrich, B. Schmied, J. Vanfleteren, J. DeBaets, A. Ostmann, and H. Reichl, "Stretchable Electronic Systems", Proc. 8<sup>th</sup> Electronics Packaging Technology Conference (EPTC), 271, IEEE Component, Packaging and Manufacturing Technology Society (CPMT) (2006).
- S. P. Lacoura, S. Wagner, Z. Huang, and Z. Suo, "Stretchable Gold Conductors on Elastomeric Substrates", Appl. Phys. Lett., 82, 2404 (2003).
- 15. K. S. Kim, Y. Zhao, H. Jang, S. Y. Lee, J. M. Kim, K. S. Kim, J. H. Ahn, P. Kim, J. Y. Choi, and B. H. Hong, "Large-Scale Pattern Growth of Graphene Films for Stretchable Transparent Electrodes", Mature Lett., 457, 706 (2009).
- T. S. Hansen, K. West, O. Hassager, and N. B. Larsen, "Highly Stretchable and Conductive Polymer Material Made from Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) and Polyurethane Elastomers", Adv. Funct. Mater., 17, 3068 (2007).
- J. A. Rogers, T. Someya, and Y. Huang, "Materials and Mechanics for Stretchable Electronics", Science, 327, 1603 (2010).
- 18. J. S. Ha, J. P. Jung, and T. S. Oh, "Effects of Intermetallic Compounds Formed during Flip Chip Process on the Interfacial Reactions and Bonding Characteristics", J. Microelectron. Packag. Soc., 19(2), 35 (2012).
- D. M. Jung, M. Y. Kim, and T. S. Oh, "Warpage Characteristics of Bottom Packages for Package-on-Package(PoP) with Different Chip Mounting Processes", J. Microelectron. Packag. Soc., 20(3), 63 (2013).
- J. Y. Choi and T. S. Oh, "A Flip Chip Process Using an Interlocking-Joint Structure Locally Surrounded by Non-conductive Adhesive", Korean J. Met. Mater., 50(10), 785 (2012).
- 21. K. J. Shin and T. S. Oh, "Micro-Power Generation Charac-

teristics of Thermoelectric Thin Film Devices Processed by Electrodeposition and Flip-Chip Bonding", J. Electron. Mater., 44(6) 2026 (2015).

- M. J. Yim and K. W. Paik, "Review of Electrically Conductive Adhesive Technologies for Electronic Packaging", Electron. Mater. Lett., 2(3), 183 (2006).
- M. A. Uddin and H. P. Chan, "Contact Resistance of Anisotropic Conductive Adhesive Film Based Flip-chip on Glass Packages", Rev. Adv. Mater. Sci., 27(2), 151 (2011).
- 24. C. Brun, C. C. Yap, D. Tan, S. Bila, S. Paccini, D. Baillargeat,

and B. K. Tay, "Flip Chip Based on Carbon Nanotube-Carbon Nanotube Interconnected Bumps for High-Frequency Applications", IEEE Trans. Nanotechnol., 12, 609 (2013).

- 25. C. C. Yap, C. Brun, D. Tan, H. Li, E. H. T. Teo, D. Baillargeat, and B. K. Tay, "Carbon Nanotube Bumps for the Flip Chip Packaging System", Nanoscale Res. Lett., 7, 105 (2012).
- L. Aryasomayajula and K. J. Wolter, Carbon Nanotube Composites for Electronic Packaging Applications: A Review", J. Nanotechnol., 2013, 296517 (2013).